### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

# 特開平11-269657

(43)公開日 平成11年(1999)10月5日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	識別記号	FI
C 2 3 C 18/12		C 2 3 C 18/12
B05D 7/24	302	B 0 5 D 7/24 3 0 2 Y
C 0 3 C 17/30		C 0 3 C 17/30 A
H01L 21/316		H 0 1 L 21/316 G
// C08J 7/06		C 0 8 J 7/06 Z
		審査請求 未請求 請求項の数28 OL (全 15 ]
(21)出願番号	特願平10-342439	(71) 出願人 000004008
		日本板硝子株式会社
(22)出顧日	平成10年(1998)12月2日	大阪府大阪市中央区道修町3丁目5番11
		(72)発明者 神谷 和孝
(31)優先権主張番号	特顏平9-334160	大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日
(32)優先日	平 9 (1997)12月 4 日	板硝子株式会社内
(33)優先檔主張国	日本(JP)	(72)発明者 寺西 豊幸
		大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日
		板硝子株式会社内
		(72)発明者 堂下 和宏
		大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日
		板硝子株式会社内
		(74)代理人 弁理士 大野 精市
		最終質に統
		1

### (54) 【発明の名称】 シリカ系膜被覆物品を製造する方法

### (57)【要約】

【課題】 焼成や前処理を必要とせずに、優れたシリカ 系膜被覆物品の製造する方法、および前記シリカ系膜を 下地膜とし、耐久性に優れた機能性膜被覆物品を、短時 間にかつ安全に製造する方法を提供する。

【解決手段】 酸およびシリコンアルコキシドをアルコールに溶解してなり、シリコンアルコキシドおよびその加水分解物 (部分加水分解物を含む)の少なくともいずれか一つがシリカ換算で 0.010~3重量%、酸0.0010~1.0規定、および水 0~10重量%を含有するコーティング液を基材に塗布してシリカ系膜を被覆した物品を製造する。また、このシリカ系膜を被覆した物品を製造する。また、このシリカ系膜を下地膜として、その上に加水分解可能な基と機能性官能基を有するオルガノシランまたはその加水分解物(部分加水分解物を含む)を塗布して、機能性膜被覆物品を製造する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 シリコンアルコキシドおよび酸を含むア ルコール溶液からなるコーティング液を基材に塗布する\* \*シリカ系膜被覆物品を製造する方法において、前記コー ティング液は、

(A)シリコンアルコキシドおよびその加水分解物(部分加水分解物を含む)の 少なくともいずれか1つ

0.010~3重量%(シリカ換算)、

(B)酸

0.0010~1.0規定、および

(C)水

0~10重量%、

を含有することを特徴とするシリカ系膜被覆物品を製造 する方法。

【請求項2】 前記コーティング液は、(A)シリカ換 算による、シリコンアルコキシドおよびその加水分解物 (部分加水分解物を含む)の少なくともいずれか1つ、 および(B)酸を、「(B)成分(規定)/(A)成分 (重量%)」が0.010以上になるように含有する請※

※求項1に記載のシリカ系膜被覆物品を製造する方法。 10 【請求項3】 前記コーティング液は、前記(B)酸お

よび(C)水を、[(B)成分(規定)×(C)成分 (重量%)]が0.0020以上になるように含有する 請求項1または2項に記載のシリカ系膜被覆物品を製造 する方法。

【請求項4】 前記コーティング液は、

(A)シリコンアルコキシドおよびその加水分解物(部分加水分解物を含む)の 少なくともいずれか1つ

0.010~0.6重量%(シリカ換算)、

(B)酸

0.010~1.0規定、 および

(C)水

0~2重量%

40

を含有する請求項1~3のいずれか1項に記載のシリカ 系膜被覆物品を製造する方法。

【請求項5】前記コーティング液は、水分含有量の0. 3倍以上の濃度を有する酸、およびシリコンアルコキシ ドをアルコールに溶解してある請求項1~4のいずれか 1項に記載のシリカ系膜被覆物品を製造する方法。

【請求項6】 前記(A)成分のシリコンアルコキシド が、テトラメトキシシランまたはテトラエトキシシラン であり、前記(B)成分が塩酸である請求項1~5のい ずれか1項に記載のシリカ系膜被覆物品を製造する方

【請求項7】 前記(A)成分の最大30重量%が、酸 化物換算で、β-ジケトン、酢酸、トリフルオロ酢酸ま たはエタノールアミンを配位子とするシリコン以外の金 属のアルコキシドのキレート化物によって置換された請 求項1~6のいずれか1項に記載のシリカ系膜被覆物品 を製造する方法。

【請求項8】 前記配位子のβ-ジケトンが、アセチル アセトンである請求項7に記載のシリカ系膜被覆物品を 製造する方法。

【請求項9】 前記金属アルコキシドが、アルミニウム またはジルコニウムのアルコキシドである請求項7また は8 に記載のシリカ系膜被覆物品を製造する方法。

【請求項10】 前記コーティング液は0~3のpHを 有する請求項1~9のいずれか1項に記載のシリカ系膜 被覆物品を製造する方法。

【請求項11】 前記基材に塗布した前記コーティング 液の膜を常温または150℃以下の温度で乾燥する請求 項1~10のいずれか1項に記載のシリカ系膜被覆物品 の製造方法。

【請求項12】 前記コーティング液を、前記塗布した 膜が5~300nmの乾燥後厚みになるように、前記基 材表面に塗布する請求項11に記載のシリカ系膜被覆物 品の製造方法。

【請求項13】 前記基材は、透明なガラス板である請 求項1~12のいずれかに記載のシリカ系膜被覆物品の 製造方法。

【請求項14】 請求項1~13のいずれか1項に記載 の方法によって得られる20~40度の静的水滴接触角 30 を有するシリカ系膜被覆物品。

【請求項15】 請求項1~13のいずれか1項に記載 の方法によって得られる表面の算術平均粗さ(Ra)= 0.10 n m以上、0.5 n m以下でかつ十点平均粗さ (Rz) = 1. 0 n m以上、5. 0 n m以下のシリカ系 膜被覆物品。

【請求項16】 基材と、その基材表面にゾルゲル法に より被覆された、酸化ケイ素を主成分とするシリカ系被 膜からなり、その被膜の表面が算術平均粗さ(Ra)= 0.10 n m以上、0.5 n m以下でかつ十点平均粗さ (Rz) = 1.0nm以上、5.0nm以下の粗さを有 するシリカ系膜被覆物品。

【請求項17】 請求項1~13のいずれか1項に記載 の方法によって得られるシリカ系膜被覆物品の表面に、 更に機能性膜用組成物を塗布する機能性膜被覆物品を製 造する方法。

【請求項18】 前記機能性膜用組成物は、加水分解可 能な官能基および機能性官能基を有するオルガノシラン ならびにその加水分解物(部分加水分解物を含む)の少 なくともいずれか1つを含む請求項17記載の機能性膜 50 被覆物品を製造する方法。

【請求項19】 前記加水分解可能な官能基はアルコキ シル基である請求項18に記載の機能性膜被覆物品を製 造する方法。

【請求項20】 前記機能性膜用組成物は、撥水膜形成 用組成物である請求項17記載の機能性膜被覆物品を製

【請求項21】 前記撥水膜形成用組成物は、アルコキ シル基およびフルオロアルキル基を分子内に含むオルガ ノシランならびにその加水分解物(部分加水分解物を含 む)の少なくともいずれか1つを含む請求項20記載の 10 機能性膜被覆物品を製造する方法。

【請求項22】 前記機能性膜用組成物は、撥水および 低摩擦抵抗膜形成用組成物である請求項17記載の機能 性膜被覆物品を製造する方法。

【請求項23】 前記撥水および低摩擦抵抗膜形成用組 成物は、アルコキシル基およびアルキル基を分子内に含 むオルガノシランならびにその加水分解物(部分加水分 解物を含む)の少なくともいずれか1つを含む請求項2 2記載の機能性膜被覆物品を製造する方法。

\*【請求項24】 前記機能性膜用組成物は、水滴の転が り性に優れ、かつ、防汚性を有する膜形成用組成物であ る請求項17記載の機能性膜被覆物品を製造する方法。 【請求項25】 前記水滴の転がり性に優れ、かつ、防 汚性を有する膜膜形成用組成物は、アルコキシル基およ びポリアルキレンオキシド基を分子内に含むオルガノシ ランならびにその加水分解物(部分加水分解物を含む) の少なくともいずれか1つを含む請求項24記載の機能 性膜被覆物品を製造する方法。

【請求項26】 請求項17~25のいずれか1項に記 載の方法によって得られる機能性膜被覆物品。

【請求項27】 請求項17~25のいずれか1項に記 載の方法によって得られる機能性膜被覆物品であって、 その被膜の表面が算術平均粗さ(Ra)=0.10nm 以上、0.5nm以下でかつ十点平均粗さ(Rz)= 1.0 n m以上、5.0 n m以下の粗さを有する機能性 膜被覆物品。

【請求項28】

(A)シリコンアルコキシドおよびその加水分解物(部分加水分解物を含む)の 少なくともいずれか1つ

> 0.010~3重量%(シリカ換算)、 0.0010~1.0規定、および

(B)酸

(C)水

(D) アルコール

0~10重量%、

残部

からなるシリカ系膜被覆用液組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はガラス、セラミック ス、ブラスチックスあるいは金属等の基材表面にシリカ 30 系膜を被覆した物品を製造する方法、シリカ系膜被覆物 品、シリカ系膜被覆用液組成物、そのシリカ系膜の上に 機能性膜を被覆した物品を製造する方法、および機能性 膜被覆物品に関する。

[0002]

【従来の技術】ガラスその他の基材の表面に機能性皮膜 を設ける際に、基材と機能性皮膜との結合強度を向上さ せること、および基材がアルカリ成分を含む場合にアル カリ成分の拡散を防止し、機能性皮膜の耐久性能を高め ることを目的として、基材と機能性膜との間にシリカそ 40 00~600℃程度での焼成が不可欠であった。さら の他の酸化物下地膜が設ける種々の技術が知られてい る。

【0003】この酸化物下地膜を設ける方法としては、 ゾルーゲル法(特公平4-20781号、特開平2-3 11332号)、クロロシランを非水系溶媒に溶かした 溶液を塗布する方法(特開平5-86353号、日本特 許第2525536号(特開平5-238781 号))、CVD法、蒸着法等が知られている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】これらの方法にあって 50 5536号)では、常温でシリカ下地膜が得られるもの

は、機能性皮膜との結合強度を向上させるため下地膜の 表面に水酸基を増やすことが主眼となっている。しか し、下地膜表面の水酸基は空気中に含まれる水を吸着し 易く、いったん水が吸着するとそれを容易に取り除くこ とが困難で、機能性膜を塗布する際に100~200℃ 程度の加熱を行うか(前記特公平4-20781号、前 記特開平2-311332号、前記特開平5-2387 81号)、あるいは、加熱が必要でない場合にも長時間 の処理(上記特開平5-86353号)が必要であっ た。

【0005】また、酸化物下地膜を形成する方法(前記 特開平2-311332号、前記日本特許第25255 36号) においては、常温で塗布するのみでは下地膜自 体の強度が低く、との強度を高めるために、塗布後に5 に、基材がアルカリを含む場合には、焼成中でのアルカ リの拡散を防止するためには、100mm以上の厚みの 酸化物下地膜を形成することが必要である。しかし、下 地膜の厚みが大きくなると、膜厚が不均一となりやす く、反射ムラ等の外観不良が発生し易くなり、また、製 造コストが高くなるなどの問題があった。

【0006】また、テトラクロロシランをパーフロオロ カーボン、塩化メチレン、炭化水素のような非水系溶媒 に溶かした溶液を塗布する方法(前記日本特許第252

の、耐擦傷性が低い。クロロシリル基は極めて反応性が 髙く、塗布液の調合、保存を水を含まない環境でおこな う必要があり、製造コストの面から好ましくない。

【0007】本発明は上記の従来技術の問題点を解決し て、焼成等の製造コストの上昇につながる処理を必要と せずに、下地膜として優れたシリカ系膜被覆物品および 耐久性に優れる機能性膜被覆物品を、短時間にかつ容易 に製造する方法を提供することを目的とする。

[0008]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた

め、本発明においては、低濃度のシリコンアルコキシド\*

\*と高濃度の揮発性の酸からなるアルコール溶液を基材に 塗布し、常温で乾燥することにより、強固でしかも表面 にアルコキシル基を有するシリカ系膜を基材表面に被覆 し、さらに、このシリカ系膜の上に加水分解可能な基と 機能性官能基を有するオルガノシランを塗布することに より、機能性膜を基材に強固に結合せしめた。

【0009】すなわち本発明は、シリコンアルコキシド および酸を含むアルコール溶液からなるコーティング液 を基材に塗布するシリカ系膜被覆物品を製造する方法に 10 おいて、前記コーティング液は、

(A)シリコンアルコキシドおよびその加水分解物(部分加水分解物を含む)の 少なくともいずれか1つ

0.010~3重量%(シリカ換算)、

(B)酸

0.0010~1.0規定、および

(C)水

0~10重量%

を含有することを特徴とするシリカ系膜被覆物品を製造 する方法である。なお、(A)成分がシリコンアルコキ シドおよびその加水分解物(部分加水分解物を含む)の

【0010】本発明において、上記コーティング液に用 いるシリコンアルコキシドは特に限定するものではない が、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テ トラプロポキシシラン、テトラブトキシシラン等を挙げ ることができるが、比較的分子量の小さいシリコンアル コキシド、例えば炭素数が3以下のアルコキシル基を有 するテトラアルコキシシランが、緻密な膜となり易いの で好ましく用いられる。またこれらテトラアルコキシシ ましく用いられる。

【0011】上記コーティング液に用いる酸触媒の種類 としては、常温の乾燥で揮発して膜中に残らないという 観点から、塩酸、弗酸、硝酸、酢酸、ギ酸、トリフルオ 口酢酸等の揮発性の酸が好ましく、なかでも、高い揮発※ ※性を有し、しかも取り扱いが比較的容易な塩酸が特に好 ましい。

【0012】また上記コーティング液に用いるアルコー 両者を含む場合は(A)成分の重量%はその合計値であ 20 ル溶媒についても特に限定するものではないが、例え ば、メタノール、エタノール、1-プロパノール、2-プロパノール、ブチルアルコール、アミルアルコール等 を挙げることができるが、それらの中で、メタノール、 エタノール、1-プロパノール、2-プロパノールのよ うな炭素数が3以下の鎖式飽和1価アルコールが、常温 における蒸発速度が大きいので好ましく用いられる。 【0013】シリコンアルコキシド、酸、および水(酸 を溶解するためのもの、溶媒中の不純物、雰囲気の湿度 から入るもの等)を含むアルコール溶液からなるコーテ

ランの重合体であって、平均重合度が5以下のものも好 30 ィング液内部で、その調合中、貯蔵中および塗布後にお いて、酸を触媒として、シリコンアルコキシドと水との 間で、式(1)に示す加水分解反応が行われる。また式 中、Rはアルキル基である。

【化1】

【化2】

 $(-Si-OR) + (H_2O) \rightarrow (-Si-OH) + (ROH) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot (1)$ 

【0014】また、加水分解反応したシラノール基(-Si-OH)同士が、式(2)に示すように脱水縮合反 応してシロキサン結合(-Si-O-Si-)を形成す ★

 $(-Si-OH) + (-Si-OH) \rightarrow (-Si-O-Si-) + (H<sub>2</sub>O)$  (2)

【0015】シリコンアルコキシド、酸、および水を含 むアルコール溶液からなるコーティング液中で、上記式 (1) のように、シリコンアルコキシドのアルコキシ基 が加水分解反応するかどうか、また、加水分解反応した シラノール基(-Si-OH)同士が、上記コーティン グ液中で上記式(2)に示すような脱水縮合反応をする かどうかは、溶液の酸濃度、シリコンアルコキシドまた はその加水分解物の濃度、水分量によって大きく左右さ れる。シリコンアルコキシドの濃度および水分量が低い ほど上記式(1)の反応が起こり難く、結果的に上記式 50 可能にした。従来技術のように溶液中でシリコンアルコ

(2)の反応も起こり難くなる、また、溶液の酸濃度が pHで0~3の範囲にあるときは上記式(1)の反応は 速やかに起こるが、上記式(2)の反応が起こり難い。 【0016】本発明において、コーティング液中のシリ コンアルコキシドは、塗布前においては、上記脱水縮合 反応を抑制して、極力低重合度のまま保持し、このコー ティング液を基材表面に塗布、乾燥する時に、急激に上 記式(1)、式(2)の反応を起こしてシロキサン結合 を形成させるため、常温で緻密な被膜を形成することを (5)

キシドを加水分解、縮重合反応させた場合、溶液を基材 表面に塗布、乾燥する時に重合体同士の結合となるため に、空隙が生じやすくなり、緻密な被膜にならず、緻密 な被膜にするために焼成硬化が必要であった。従って、 本発明において、コーティング液中のシリコンアルコキ シドおよびその加水分解物(部分加水分解物を含む) は、単量体または20量体未満の重合体であることが好 ましい。しかし、単量体、および20量体未満の重合体 の合計がシリコンアルコキシドおよびその加水分解物 (部分加水分解物を含む)全体に対して80重量%以上 10

【0017】本発明において、上記コーティング液中の 酸触媒の濃度を0.0010~1.0規定に保つことに より、コーティング液のpHが0~3となり、特にpH が約2のときに、上記式(1)の残りのアルコキシル基 の加水分解反応、および上記式(2)の脱水縮合反応が 塗布前のコーティング液中で起こりにくくなり、コーテ ィング液が塗布された直後に急激にこれらの反応が進行 する。コーティング液中の酸の好ましい濃度は0.01 20 ~1.0規定である。

を占める場合には、20量体以上の重合体が含まれてい

ても差し支えない。

【0018】触媒として添加する酸は、水分含有量の 0. 3倍以上の高い濃度を有することが、上記コーティ ング液中の酸の濃度を維持するために好ましい。すなわ ち、水溶液の状態の酸を使用するときは、23.1%以 上の濃度を有する高濃度の酸、例えば約6.3規定以上 の塩酸水溶液であることが好ましい。またエタノールに 溶解した状態の酸を触媒として添加するときには、この エタノール溶液が例えば0.5重量%の水分を含有して いるとすれば、エタノール溶液中の酸の濃度は0.15 重量%(0.5重量%の0.3倍)以上、例えば塩酸で は0.04規定以上、であることが好ましい。

【0019】また、コーティング液中のシリコンアルコ キシドおよびその加水分解物(部分加水分解物を含む) の合計の濃度は、できるだけ低い方が、上記コーティン グ液のpHと相俟って、上記式(1)の残りのアルコキ シル基の加水分解反応、および式(2)の脱水縮合反応 が塗布前のコーティング液中で起こりにくくなるので好 ましい。しかしこの濃度があまり低すぎるとシリカ膜の 厚みが小さくなり過ぎて、例えば膜厚が5 n m未満にな 40 には、コーティング液中の酸触媒の濃度を比較的に高く って、均一に基材を覆うことが困難となり、基材がアル カリ成分を含む場合にアルカリ成分の拡散を防止する能 力が低下して、耐久性能が劣る傾向があり、またその上 に機能性膜を被覆する場合、機能性膜を強固にシリカ膜 に結合することができなくなる。またシリコンアルコキ シドおよびその加水分解物(部分加水分解物を含む)の 合計濃度が3重量%を超えると、得られるシリカ膜の厚 みが300nmを超え、膜に傷がつき易く強固な膜とな らない。従ってコーティング液中のシリコンアルコキシ ドおよびその加水分解物(部分加水分解物を含む)の合 50 とが好ましい。

計濃度(20量体未満の重合体も含む)の範囲は、シリ カに換算して0.010~3重量%であり、好ましい範 囲は、0.010~0.6重量%である。

【0020】また、コーティング液中のシリコンアルコ キシドおよびその加水分解物(部分加水分解物を含む) の濃度が比較的に高く保たれる場合には、コーティング 液中の酸触媒の濃度も比較的に高く保つことが好まし い。具体的には、コーティング液は、(A)シリカ換算 による、シリコンアルコキシドおよびその加水分解物 (部分加水分解物を含む) および (B) 酸を、「(B) 成分(規定)/(A)成分(重量%)」が0.010以 上になるように含有することが好ましく、0.03以上 になるように含有することが更に好ましい。

【0021】コーティング液中に多量の水が存在する と、液中でシリコンアルコキシドの加水分解反応が促進 され、かつ脱水縮合反応が起こりやすくなり、またコー ティング液塗布後の乾燥の際に膜厚のムラが生じ易くな るので、コーティング溶液中の水の濃度はできるだけ小 さい方が好ましい。従って、コーティング液中の水の濃 度は0~10重量%であり、0~2重量%であることが 好ましい。

【0022】このようにコーティング溶液中の水の濃度 を維持することにより、上記のコーティング液のpH維 持およびコーティング液中のシリコンアルコキシドおよ びその加水分解物(部分加水分解物を含む)の合計濃度 維持と相俟って、上記式(1)の残りのアルコキシル基 の加水分解反応、および式(2)の脱水縮合反応が塗布 前のコーティング液中で起こりにくくなるので好まし い。コーティング液中の水の濃度がゼロであっても、基 30 材に塗布された後の塗布膜には空気中の水分が吸収され るので加水分解反応が阻害されることはない。しかし、 通常のアルコール溶媒には元々若干の水が含まれ、ま た、酸は水溶液の形で添加することが多いので、コーテ ィング液中の水の濃度は通常は0.1重量%以上とな **み**-

【0023】また、コーティング液中の酸触媒の濃度が 比較的に低く保たれる場合には、コーティング液中の水 の含有量を比較的に高く保つことが好ましく、またコー ティング液中の水の含有量が比較的に低く保たれる場合 保つことが好ましい。具体的には、コーティング液は、

(B)酸および(C)水を、[(B)成分(規定)× (C)成分(重量%)]が0.0020以上になるよう に含有することが好ましい。例えば、コーティング液中 の酸触媒の濃度が0.003規定未満で水の濃度がゼロ またはあまり低い場合には、塗布膜への空気中からの水 分吸収だけでは加水分解反応が不十分となりやすい。従 って酸触媒の濃度が例えば0.0010規定のコーティ ング液中には水が約2.0重量%以上含有されているこ

【0024】シリコンアルコキシドおよび酸を上記の割 合でアルコール溶媒に溶解した溶液を撹拌すると、溶液 中では、上記式(1)の反応により主としてシリコンア ルコキシドが加水分解物を形成し、かつ、前記式(2) の反応によりその加水分解物の一部が脱水縮合反応す る。このようにしてコーティング液が調製され、このコ ーティング液中には、シリコンアルコキシドが単量体 (加水分解物を含む) または20量体未満の重合体の形 で存在する。

【0025】上記コーティング液が基材に塗布される と、塗布されて膜状となった液の比表面積が増大するの で、膜中のアルコール溶媒が急速に蒸発して、シリコン アルコキシドおよびその加水分解物(部分加水分解物を 含む)の合計の塗膜中濃度が急に高くなり、それまで抑 制されていた加水分解反応および脱水縮合反応(上記2 0 量体未満の重合体の更なる縮重合反応を含む) が急激 に起こってシロキサン結合 (··Si-O-Si··) が塗布 膜内で多数生成され、その結果、基材表面と膜との間の 結合が強固な、膜厚が5~300mmのシリカを主成分 とする緻密性の高い膜が形成される。このように、本発 20 明においては、成膜時の反応性が高く、室温で反応し て、非常に緻密な膜が形成され、その後の焼成は必要で はない。

【0026】従来のように塗布前のコーティング液中 に、すでに脱水縮合反応によるシロキサン結合が多数存 在して、20以上の重合度の重合体が含有され場合に は、得られたシリカ膜中にシロキサン結合は存在する が、基材表面とシリカ膜とをつなぐシロキサン結合はそ れほど多く生成されないので、基材表面とシリカ膜との 間の結合はそれほど強固ではない。そしてこの結合を強 30 または、親水処理された金属やプラスチックスの基材の 固にするために、従来は、更に高温度の焼成を必要とす る。

【0027】さらに、本発明によれば、前記コーティン グ液中でまだ完全には加水分解していなかったシリコン アルコキシド部分加水分解物の加水分解反応および脱水 縮合反応が塗布膜中で同時に進行するので、形成された シリカ膜表面にはアルコキシル基が加水分解されずに残 っており、後述のように、このシリカ膜を下地膜として その上に機能性膜を被覆するときに、機能性膜の付着性 を向上させることができる。従来のゾルーゲル法で緻密 なシリカ膜を形成するには、脱水縮合したシリカ膜を通 常500~600℃で加熱する必要がある。

【0028】本発明では、上記コーティング液を塗布し た後に、常温で、または150℃以下の温度で、30秒 間~5分間、自然乾燥または強制乾燥するだけで緻密な シリカ膜が形成される。もし上記塗布膜を150℃以上 の温度で加熱すれば、シリカ膜はそれ以上緻密にはなら ないだけでなく、シリカ膜の上に被覆させる機能性膜の 付着性を向上させることができなくなる。

【0029】上記のシリカ膜表面にアルコキシル基が残 50 M)(セイコー電子工業(株)製、走査型プローブ顕微

存しているかどうかは、シリカ膜表面の静的水滴接触角 を測定することによって知ることができる。後に実施例 で示すように本発明によるシリカ膜表面の静的水滴接触 角は20~40度である。これに対して例えば従来のゾ ルーゲル法でシリカ膜を形成し、膜の緻密化のために5 00~600℃で焼成した場合には、静的水滴接触角の 値は数度以下となる。とのように静的水滴接触角が低く なるのは、焼成の前のシリカ膜表面にはアルコキシル基 が残っているものの、上記焼成によりアルコキシル基が 分解されてシリカ膜表面の水酸基が増えて親水化すると とによるものと考えられる。

10

【0030】表面に水酸基を有するシリカ膜を下地膜と して、その上にオルガノシランを含む機能性膜用液を塗 布しても、通常の環境では、オルガノシランを塗布する 前に、シリカ下地膜表面の水酸基に空気中の水分が結合 して、水が下地膜表面に吸着してしまっているために、 常温でシリカ下地膜とオルガノシランの間の化学結合を 形成することが困難となるのである。

【0031】本発明においては、シリカ膜表面にはアル コキシル基が多く残っており、水酸基は少ないので、空 気中の水分が下地膜表面に吸着することが防止されると 考えられる。従って、とのシリカ下地膜にオルガノシラ ンを含む機能性膜用液を塗布した場合には、シリカ下地 膜のアルコキシル基とオルガノシランのシラノール基 (水酸基または加水分解した官能基) との反応により、 常温でシリカ下地膜とオルガノシランの間の化学結合を 形成することができ、機能性膜をシリカ下地膜に強固に 付着させることができる。

【0032】酸化物系の下地、ガラスやセラミックス、 表面に関しても、そのままでは上記と同様に、塗布した オルガノシランの間の化学結合を形成することが困難で あるが、本発明によってアルコキシル基が残存するシリ カ下地膜をとれらの基材表面に形成させるととにより、 機能性膜を基材に強固に付着させることができる。この シリカ下地膜は髙温に加熱されると、残存していたアル コキシル基が消失し、それに代わって水酸基が形成され るので、その上に被覆させる機能性膜を強固に付着させ ようとするときには、シリカ下地膜を予め150℃を越 える温度で加熱すべきではない。

【0033】また、本発明で成膜されたシリカ膜はその 表面の平滑性が非常に優れている。従って、このシリカ 膜の下地の上に機能性オルガノシランを塗布することに よって得られる機能性膜も、その表面の平滑性が非常に 優れている。すなわち、シリカ膜および機能性膜の表面 は算術平均粗さ(Ra)=0.5nm以下、特に0.1 0~0.5 nm、でかつ十点平均粗さ(Rz)=5.0 nm以下、特に1.0~5.0nm、の粗さを有する。 この表面粗さRaおよびRzは、原子間力顕微鏡(AF

鏡「SPI3700」、カンチレパー;シリコン製「S I-DF20」)を用いて、二次元で定義されるJIS B 0601を三次元に拡張した方法で測定することが できる。との場合、試料の測定面積は  $1 \mu m \times 1 \mu m$ の 正方形であり、測定点数 512×256点、スキャン 速度1.02Hz、DFM(サイクリックコンタクトモ ード) にて表面形状を測定し、ローパスフィルターによ る補正と、測定データのレベリング補正(最小二乗近似 によって曲面を求めてフィッティングし、データの傾き を補正し、更に Z軸方向の歪みを除去する)を行い、表 10 面粗さRaおよびRz値を算出した。

【0034】本発明によるシリカ系膜の上に被覆した機 能性膜が優れた撥水性、優れた低摩擦抵抗性、優れた水 滴の転がり性、優れた防汚性、および優れた耐久性を示 す理由の一つは、平滑性の優れたシリカ膜の上に被覆し た機能性膜表面の優れた平滑性によると推定される。そ してこのシリカ膜の優れた平滑性が得られる理由は次の ように推測される。すなわち、塗布前のコーティング液 中で、シリコンアルコキシドが単量体(加水分解物を含 む)または20量体未満の重合体の形で溶媒中に均一に 溶解しており、しかも塗布された後には高濃度の酸触媒 の存在およびシリコンアルコキシド(加水分解物を含 む)の濃度の急速上昇の効果で、室温で緻密なシリカ膜 を形成させるために優れた平滑性が得られると推測され

【0035】それに対して、本発明において用いるシリ コンアルコキシドに代えて、例えば、テトラクロロシラ ンのようなクロロシリル基含有化合物を非水系溶媒に溶 解した液を塗布した場合は、クロロシリル基含有化合物 られた膜の表面粗さは、例えば、算術平均粗さ(Ra) = 7. 9 n m、十点平均粗さ(Rz) = 29. 8 n m で あり、本発明に比して膜の平滑性が劣っている。

【0036】以上は、シリカ単体からなる膜の被覆物品 について説明したが、シリカを主成分とする膜の被覆物 品にも適用することができる。すなわち膜成分として、 アルミニウム、ジルコニウム、チタニウム、セリウム等 のシリコン以外の酸化物を添加し、酸化物換算で上記シ リカの最大30重量%まで、通常は1~30重量%を置 換してシリカ系の多成分酸化物膜とすることによって、 さらに耐久性を向上させることができる。なかでも、ア ルミニウム、ジルコニウムは、下地膜自体を強固にし、 さらに機能性皮膜との結合を強固にするので好ましい。 シリコン以外の酸化物の添加量は1重量%より少ないと 添加効果が得られず、また、30重量%より多いと膜の 緻密性が損なわれ強固な膜とならない。

【0037】これらの酸化物の添加は、これらの金属の アルコキシドを、βージケトン、酢酸、トリフルオロ酢 酸、エタノールアミン等で化学修飾したキレート化物の 形で添加することが好ましい。特に、β-ジケトンの― 50 【0044】フロオロアルキル基を含有するオルガノシ

種であるアセチルアセトンで化学修飾して添加すると、 溶液の安定性が優れ、また、比較的強固な膜となるので 好ましい。

【0038】本発明に係るシリカ系膜被覆物品の製造 は、上記のアルコール溶液からなるコーティング液を、 常温常圧下で、ガラス、セラミックス、プラスチックス あるいは金属等の基材表面に塗布し、常温常圧下で、ま たは150℃以下の温度で、30秒間~5分間、自然乾 燥または強制乾燥することによりおこなわれる。

【0039】ガラス、セラミックス、金属のような基材 表面には水酸基のような親水性基が存在するので、上記 コーティング液を塗布したときに基材上に塗膜が形成さ れる。しかし、プラスチックス基材の種類によってはそ の表面に親水性基が少なく、アルコールとの濡れが悪い ために、コーティング液が基材表面ではじかれて塗膜が 形成され難いことがある。このように表面の親水性基が 少ない前記基材の場合には、その表面を、予め酸素を含 むプラズマまたはコロナ雰囲気で処理して親水性化した り、あるいは、基材表面を酸素を含む雰囲気中で200 ~300 n m付近の波長の紫外線を照射して、親水性化 処理を行った後に、シリカ系膜被覆処理を行うことが好 **生しい。** 

【0040】また、シリカ系膜形成用コーティング液の 塗布方法は、特に限定されるものではないが、例えばデ ィップコート、フローコート、スピンコート、バーコー ト、ロールコート、スプレーコート、手塗り法、刷毛塗 り法などが挙げられる。

【0041】本発明によれば、ガラス、セラミックス、 金属、プラスチックスなどの基材の表面に、高温に加熱 の反応性が非常に高いために、反応が不均一となり、得 30 することなく、緻密で硬いシリカ系皮膜を形成すること ができる。また基材からのアルカリを遮断する性能を有 し、または基材と機能性膜との結合強度を向上させる下 地膜としても有用であり、上記シリカ系膜上に、例えば 加水分解可能な基および機能性官能基、を有するオルガ ノシランまたはその加水分解物(部分加水分解物を含 む)を塗布したり、その他の被覆をおこなうことによっ て、撥水、撥油、防曇、防汚、低摩擦抵抗、反射防止そ の他の光学膜、導電膜、半導体膜、保護膜等の機能性膜 を形成することができる。

> 【0042】上記オルガノシランの加水分解可能な基 は、特に限定されるものではないが、ハロゲン、ハイド ロジェン、アルコキシル、アシロキシ、イソシアネート 等が挙げられる。特に、アルコキシル基は、反応が極端 に激しくなく、保存等の取り扱いが比較的容易であるの で好ましい。

【0043】例えば、撥水・撥油の機能性膜の被覆方法 としては、特に限定されないが、撥水性官能基としての フロオロアルキル基、および加水分解可能な基を含有す るオルガノシランを用いて処理する方法が好ましい。

ランとしては、CF, (CF,),, (CH,), SiC1,、 CF, (CF<sub>1</sub>), (CH<sub>1</sub>), Si(Cl), CF, (C  $F_1$ ),  $(CH_2)$ , SiCI, CF,  $(CF_2)$ ,  $(CH_2)$  $_{1}$ SiCl, CF, (CF,), (CH<sub>2</sub>), SiCl, CF ,(CF<sub>2</sub>),(CH<sub>2</sub>),SiCl<sub>3</sub>,CF<sub>3</sub>(CF<sub>2</sub>),(C  $H_1$ ),  $SiCl_3$ ,  $CF_3$  ( $CF_2$ ), ( $CH_2$ ), SiC1, CF, (CF,), (CH,), SiC1, CF, (C F,), (CH,), SiCl, CF, CF, (CH,), Si Cl, CF, (CH,), SiCl,のようなパーフロオ ロアルキル基含有トリクロロシラン; CF, (CF,), (CH<sub>2</sub>),Si(OCH<sub>3</sub>), CF<sub>3</sub>(CF<sub>4</sub>)<sub>10</sub>(C H<sub>2</sub>),Si(OCH<sub>3</sub>), CF, (CF<sub>2</sub>), (CH<sub>2</sub>),S i(OCH<sub>1</sub>), CF<sub>1</sub>(CF<sub>2</sub>), (CH<sub>2</sub>), Si(OC H<sub>3</sub>), CF, (CF<sub>2</sub>), (CH<sub>2</sub>), Si(OCH<sub>3</sub>), CF, (CF<sub>2</sub>), (CH<sub>2</sub>), Si (OCH<sub>3</sub>), CF , (CF<sub>1</sub>), (CH<sub>2</sub>), Si (OCH<sub>3</sub>), CF<sub>3</sub> (C F<sub>1</sub>), (CH<sub>2</sub>), Si (OCH<sub>3</sub>), CF, (CF<sub>2</sub>) , (CH<sub>2</sub>), Si (OCH<sub>3</sub>), CF, (CF<sub>2</sub>), (C  $H_1$ ),  $Si(OCH_3)$ ,  $CF_3CF_2(CH_2)$ , Si(O $CH_1$ ),  $CF_1$  ( $CH_2$ ), Si ( $OCH_3$ ), CF, (CF<sub>1</sub>)<sub>11</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>Si (OC<sub>2</sub>H<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, CF<sub>3</sub> (C  $F_{1}$ ), (CH<sub>2</sub>), Si (OC, H<sub>5</sub>), CF, (CF<sub>2</sub>),  $(CH_{2})_{1}Si(OC_{2}H_{3})_{3}, CF_{3}(CF_{2})_{3}(CF_{3})_{3}$  $H_{1}$ ),  $Si(OC_{1}H_{5})$ ,  $CF_{3}(CF_{1})$ ,  $(CH_{1})$ , Si(OC, H,), CF, (CF,), (CH,), Si(O  $C_1H_1$ ,  $CF_1$  ( $CF_2$ ), ( $CH_2$ ), Si (OC,H,), CF, (CF,), (CH,), Si (OC ,H,),, CF, (CF,), (CH,), Si (OC ,H<sub>5</sub>), CF, (CF<sub>2</sub>), (CH<sub>2</sub>), Si (OC ,H,), CF,CF, (CH,),Si(OC,H,), C  $F_{1}(CH_{1})_{1}S_{1}(OC_{1}H_{1})_{1}$  のようなパーフロオロ アルキル基含有トリアルコキシシラン; CF, (CF,) 11 (CH<sub>2</sub>), Si (OCOCH<sub>3</sub>), CF, (CF<sub>2</sub>) 10  $(CH_1)_1Si(OCOCH_1)_1, CF_1(CF_1)_1(CF_1)_1$  $H_2$ ), Si(OCOCH<sub>3</sub>), CF<sub>3</sub>(CF<sub>4</sub>), (C H<sub>2</sub>), Si (OCOCH<sub>3</sub>), CF, (CF<sub>2</sub>), (C  $H_2$ ), Si(OCOCH,), CF, (CF,), (C  $H_{i}$ ),  $Si(OCOCH_{i})$ ,  $CF_{i}(CF_{i})$ , (C $H_1$ ), Si (OCOCH,), CF, (CF<sub>2</sub>), (C  $H_{i}$ ), Si (OCOCH<sub>i</sub>), CF, (CF<sub>i</sub>), (C  $H_{i}$ ), Si(OCOCH<sub>i</sub>), CF<sub>i</sub>(CF<sub>i</sub>), (C  $H_{i}$ ),  $Si(OCOCH_{i})$ ,  $CF_{i}CF_{i}(CH_{i})$ , Si(OCOCH,), CF, (CH,), Si (OCOC H,),のようなパーフロオロアルキル基含有トリアシ ロキシシラン; CF, (CF,), (CH,), Si(NC O), CF, (CF<sub>2</sub>), (CH<sub>2</sub>), Si (NCO), CF, (CF<sub>2</sub>), (CH<sub>2</sub>), Si (NCO), CF, (C F<sub>1</sub>), (CH<sub>2</sub>), Si (NCO), CF, (CF<sub>2</sub>) , (CH<sub>2</sub>),Si(NCO), CF, (CF<sub>2</sub>), (C

(NCO), CF, (CF,), (CH,), Si (NC O), CF, (CF,), (CH,), Si (NCO), C F, (CF<sub>1</sub>), (CH<sub>2</sub>), Si (NCO), CF, CF<sub>1</sub> (CH<sub>2</sub>), Si (NCO), CF, (CH<sub>2</sub>), Si (NC 〇),のようなパーフロオロアルキル基含有トリイソシ アネートシランを例示することができる。

【0045】また、アルキル基を含有するオルガノシラ ンを用いて処理することによって、撥水、あるいは、低 摩擦抵抗の機能性膜を得ることができる。特に限定され るものではないが、炭素数1~30の直鎖状のアルキル 基、および加水分解可能な基を含有するオルガノシラン が好ましく利用できる。

【0046】アルキル基を含有するオルガノシランとし ては、CH, (CH,), SiCl, CH, (CH,), S iCl, CH, (CH,), SiCl, CH, (CH,),  $SiCl_{1}$ ,  $CH_{1}$  ( $CH_{1}$ ),  $SiCl_{1}$ ,  $CH_{1}$  ( $CH_{1}$ ) 1, SiCl, CH, (CH,) 10 SiCl, CH, (C  $H_2$ ), SiCl, CH, (CH<sub>2</sub>), SiCl, CH, (C  $H_2$ ), SiCl, CH, (CH<sub>2</sub>), SiCl, CH, (C  $H_1$ ), SiCl, CH, (CH<sub>2</sub>), SiCl, CH, (C  $H_2$ ), SiCl, CH, (CH<sub>2</sub>), SiCl, CH, CH ,SiCl, (CH,CH,),SiCl, (CH,CH,) ,SiCl, CH, SiCl, (CH,), SiCl, (C  $H_1$ ), SiCloston のようなアルキル基含有クロロシラン; CH, (CH<sub>2</sub>), Si (OCH<sub>3</sub>), CH, (CH<sub>2</sub>), Si(OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>1</sub>,Si(OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, CH, (CH,) 16Si (OCH,), CH, (CH,) 14 Si(OCH<sub>1</sub>), CH<sub>1</sub>(CH<sub>1</sub>)<sub>1</sub>, Si(OCH<sub>1</sub>), CH, (CH<sub>2</sub>)<sub>10</sub>Si(OCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, CH, (CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>S i(OCH<sub>1</sub>)<sub>3</sub>, CH<sub>1</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub>Si(OCH<sub>1</sub>)<sub>3</sub>, C H, (CH<sub>2</sub>),Si(OCH<sub>3</sub>), CH, (CH<sub>2</sub>),Si (OCH,), CH, (CH,), Si (OCH,), CH , (CH<sub>2</sub>),Si(OCH<sub>3</sub>), CH, (CH<sub>2</sub>),Si(O  $CH_1$ ),  $CH_2$ ( $CH_2$ ),  $Si(OCH_3$ ),  $CH_3C$  $H_{i}Si(OCH_{i})_{i}$ ,  $(CH_{i}CH_{i})_{i}Si(OC$ H<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, (CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>3</sub>SiOCH<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub>Si (OC H<sub>1</sub>), (CH<sub>1</sub>), Si(OCH<sub>1</sub>), (CH<sub>1</sub>), SiO  $CH_{1}$ ,  $CH_{2}$  ( $CH_{2}$ )  $_{1}$ ,  $Si(OC_{2}H_{3})$   $_{3}$ ,  $CH_{3}$  ( $CH_{3}$ ) H<sub>2</sub>) <sub>20</sub> Si (OC<sub>2</sub>H<sub>3</sub>) <sub>3</sub>, CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>) <sub>10</sub> Si (OC 40 ,H,), CH, (CH,), Si(OC,H,), CH , (CH<sub>2</sub>)<sub>14</sub>Si (OC<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>12</sub>Si  $(OC_1H_1)_1$ ,  $CH_1$ ,  $(CH_2)_1$ ,  $Si(OC_1H_1)_1$ , CH, (CH,), Si (OC, H,), CH, (CH,), S i(OC,H,), CH, (CH,),Si(OC,H,), CH, (CH,), Si (OC, H,), CH, (CH,), S i (OC, H, ), CH, (CH, ), Si (OC, H, ), CH, (CH,),Si(OC,H,), CH, (CH,),S i (OC, H, ), CH, CH, Si (OC, H, ), (CH ,CH<sub>2</sub>),Si(OC,H<sub>5</sub>), (CH,CH<sub>2</sub>),SiOC,  $H_2$ ), Si(NCO), CF,  $(CF_2)$ ,  $(CH_2)$ , Si 50 H, CH,  $Si(OC_2H_3)$ ,  $(CH_3)$ ,  $Si(OC_2H_3)$ 

プロピル] トリメトキシシラン等が好ましく用いられ る。

,),、(CH,),SiOC,H, のようなアルキル基含 有アルコキシシラン; CH, (CH,), Si(OCOC H,), CH, (CH,), Si (OCOCH,), CH, (CH<sub>2</sub>)<sub>18</sub>Si(OCOCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub>(CH<sub>2</sub>)<sub>16</sub>S i (OCOCH<sub>1</sub>) , CH<sub>2</sub> (CH<sub>2</sub>) , Si (OCOCH ,), CH, (CH,), Si (OCOCH,), CH , (CH<sub>2</sub>), Si (OCOCH,), CH, (CH<sub>2</sub>), S i(OCOCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>8</sub>Si(OCOC H,), CH, (CH,), Si (OCOCH,), CH, (CH<sub>2</sub>), Si (OCOCH<sub>3</sub>), CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>), Si (OCOCH<sub>3</sub>)<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>)<sub>4</sub>Si (OCOC H,), CH, (CH,), Si(OCOCH,), CH, (CH<sub>2</sub>), Si (OCOCH<sub>3</sub>), CH<sub>3</sub>CH<sub>4</sub>Si (OC  $OCH_1$ ),  $(CH_1CH_2)_2Si(OCOCH_3)_3$ . (CH, CH,), SiOCOCH, CH, Si (OCOC  $H_{i}$ ), (CH<sub>i</sub>), Si(OCOCH<sub>i</sub>), (CH<sub>i</sub>), SiOCOCH,のようなアルキル基含有アシロキシシ ラン; CH, (CH,), Si(NCO), CH, (C H<sub>2</sub>) 20 Si (NCO) 3, CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>) 18 Si (NC O), CH, (CH<sub>2</sub>)<sub>16</sub>Si(NCO), CH, (CH 2) 14 Si (NCO) 3, CH3 (CH2) 12 Si (NCO) , CH, (CH<sub>2</sub>)<sub>10</sub>Si(NCO), CH, (CH<sub>2</sub>), Si(NCO), CH, (CH,), Si(NCO), C H<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>), Si (NCO)<sub>3</sub>, CH<sub>3</sub> (CH<sub>2</sub>), Si (NCO), CH, (CH,), Si(NCO), CH, (CH<sub>2</sub>), Si (NCO), CH, (CH<sub>2</sub>), Si (NC O), CH, (CH,), Si (NCO), CH, CH, S  $i(NCO)_{1}$ ,  $(CH_{1}CH_{2})_{2}Si(NCO)_{2}$ , (CH, CH, ), SiNCO, CH, Si(NCO), (C H<sub>3</sub>),Si(NCO), (CH<sub>3</sub>),SiNCO のような アルキル基含有イソシアネートシランを例示することが できる。

【0049】これらのオルガノシランをアルコール溶媒 に溶解し、酸触媒を用いて加水分解した溶液を前記シリ カ系膜(下地膜)上に塗布することによって、特に熱処 理を施すことなく、下地膜表面のアルコキシル基とオル ガノシランのシラノール基との脱アルコール反応が起と り、シロキサン結合を介して下地膜とオルガノシランが 結合される。また、上記オルガノシランの加水分解性官 10 能基の反応性が高い場合、例えば、上記オルガノシラン がクロル基、イソシアネート基、アシロキシ基等を有す る場合は、下地膜表面にアルコキシル基とともに存在す るシラノールや微量の水と反応することにより、下地膜 とオルガノシランの結合が形成されるので、上記オルガ ノシランを、希釈しないでそのままで塗布したり、また はパーフロオロカーボン、塩化メチレン、炭化水素、シ リコーンのような非水系溶媒で希釈しただけの液を塗布 してもよい。このようにアルコキシル基が表面に残存す るシリカ系膜を下地膜とすることにより、機能性膜を基 20 材に強固に付着させることができる。

【0047】さらに、ポリアルキレンオキシド基、およ び加水分解可能な基を分子内に有するオルガノシランを 用いて処理することによって、水滴の転がり始める臨界 傾斜角が低く、かつ、汚れが吸着あるいは付着しにくい 機能性膜を得ることができる。

【0050】機能性膜膜の塗布方法としては、シリカ系 膜被覆処理の場合と同様に、特に限定されないが、フロ ーコート、ロールコート、スプレーコート、手塗り法、 刷毛塗り法などが挙げられる。

【0048】上記ポリアルキレンオキシド基としては、 ポリエチレンオキシド基、ポリプロピレンオキシド基な どが主に使用される。これらの基を有するオルガノシラ ンとして、例えば、[アルコキシ(ポリアルキレンオキ シ) アルキル] トリアルコキシシラン、N-(トリエト キシシリルプロピル) - O - ポリエチレンオキシドウレ タン、[アルコキシ(ポリアルキレンオキシ)アルキ ル] トリクロロシラン、N-(トリクロロシリルプロピ ル) - O - ポリエチレンオキシドウレタンのようなオル ガノシランが上げられるが、より具体的には[メトキシ (ポリエチレンオキシ) プロビル] トリメトキシシラ ン、[メトキシ(ポリエチレンオキシ)プロピル]トリ エトキシシラン、 [ ブトキシ(ポリプロピレンオキシ) 50 込んだ後、過剰に付着した撥水処理剤を新しい綿布で拭

[0051]

30

【発明の実施の形態】以下に本発明の実施例を説明す る。

【0052】 [実施例1] エタノール (ナカライテスク 製) 98.6gに、テトラエトキシシラン (信越シリコ ーン製) 0.4g、濃塩酸(35重量%、関東化学製) 1gを攪拌しながら添加し、シリカ膜処理液を得た。こ の処理液中のテトラエトキシシラン(シリカ換算)、塩 酸および水の含有量は表1に示す通りである。

【0053】次いで、CF、(CF,),(CH,),Si (OCH<sub>1</sub>)<sub>1</sub>(ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシ シラン、東芝シリコーン製) 1 gをエタノール98gに 溶解し、更に0.1規定塩酸を1.0g添加し、1時間 攪拌し、撥水処理剤を得た。

【0054】洗浄したソーダ石灰珪酸塩ガラス基板(3 40 00×300mm)上に、湿度30%、室温下で上記シ リカ膜処理液をフローコート法にて塗布し、約1分で乾 燥し、ガラス基板表面に厚みが約40nmのシリカ膜を 被覆した。このシリカ膜の硬度を鉛筆硬度で測定したと ころ、「H」の芯の鉛筆で膜を引っ掻いても膜は傷つか なかった。なお、上記シリカ膜処理液は、室温で約10 日間そのまま置いた後に使用しても全く同じ結果が得ら れた。

【0055】との後、とのシリカ膜が被覆されたガラス 基板表面に、綿布に3mlの上記撥水処理剤をつけ塗り

き取り、撥水処理ガラスを得た。

【0056】との撥水処理ガラスについて、接触角計 (CA-DT、協和界面科学製)を用いて、水滴重量2 mgとして初期の静的水滴接触角(以下、単に接触角と いう)を測定した。得られた膜の平滑性は、原子間力顕 微鏡 (SPI3700、セイコー電子 (株) 製) を用い て、サイクリックコンタクトモードにて、表面形状を測 定し、表面粗さRa、及びRz値を算出した。摩擦試験 として、往復摩耗試験機(新東科学製)に乾布を取り付 けて、荷重0.3kg/cm'の条件で撥水膜表面を3 000回往復摺動させ、その後に接触角を測定した。ま た撥水剤塗布前のシリカ膜表面の接触角も、参考のため に測定した。なお、清浄なガラス基材そのものの接触角 は約数度以下である。これらの測定結果を表2に示す。 【0057】また摩擦試験前の撥水膜表面を肉眼で観察 して膜のムラの有無を測定し、表2に、膜ムラのない場 合を「OK」、膜ムラが生じた場合を「NG」とそれぞ れ表した。表2に示すように、シリカ膜表面の接触角は 30度、撥水処理後の初期接触角は108度、摩擦試験 後の接触角は95度を示した。シリカ膜の表面粗さは、 Ra=0.4nm、Rz=2.9nmであり、撥水処理 後の膜表面の粗さは、Ra=0.3nm、Rz=2.8 nmであった。またシリカ膜を被覆する前の洗浄済みソ ーダ石灰珪酸塩ガラス基板の膜表面の粗さは、Ra= 0.7nm、Rz=8.0nmであった。

【0058】 [実施例2] 実施例1でのシリカ膜処理液の調合に用いたテトラエトキシシランをテトラメトキシシラン(東京化成製)に代えた以外は、実施例1と同様にして撥水処理ガラスを得た。シリカ膜処理液の組成を表1に、シリカ膜の厚み、各種接触角、表面粗さ等を表302にそれぞれ示す。表2に示すように、撥水剤塗布前のシリカ膜表面の接触角は31度、撥水処理後の初期接触角は108度、摩擦試験後の接触角は97度を示した。シリカ膜の表面粗さは、Ra=0.3nm、Rz=2.8nmであり、撥水処理後の膜表面の粗さは、Ra=0.3nm、Rz=2.7nmであった。

【0059】[実施例3]シリカ膜処理液の塗布をスプレー法に代えた以外は、実施例1と同様にして撥水処理ガラスを得た。表2に示すように、撥水剤塗布前のシリカ膜表面の接触角は30度、撥水処理後の初期接触角は108度、摩擦試験後の接触角は95度を示した。シリカ膜の表面粗さは、Ra=0.4nm、Rz=3.0nmであり、撥水処理後の膜表面の粗さは、Ra=0.4nm、Rz=2.9nmであった。

【0060】 [実施例4] エタノール64. 8gに、アセチルアセトン9. 8g、アルミニウムートリーsecーブトキシド(関東化学製)25.4gを溶解し、酸化物換算で5重量%のアルミナ原料液を得た。

【0061】上記アルミナ原料液0.12g、テトラエトキシシラン0.33g、濃塩酸1gとエタノール9

8.5gを混合して、シリカ系膜処理液とした。このシリカ系膜処理液の組成を表1に示す。

18

【0062】実施例1のシリカ処理液に代えて上記シリカ系膜処理液を使用する以外は、実施例1と同様にして撥水処理ガラスを得て測定を行った。シリカ膜の厚み、各種接触角、表面粗さ等を表2にそれぞれ示す。表2に示すように、撥水剤塗布前のシリカ系膜表面の接触角は31度、撥水処理後の初期接触角は106度、摩擦試験後の接触角は104度を示した。シリカ膜の表面粗さは、Ra=0.4nm、Rz=3.0nmであった。

【0063】 [実施例5] エタノール78.6 g に、アセチルアセトン4.1 g、ジルコニウムーテトラーn-7トキシド(関東化学製)17.4 g を溶解し、酸化物換算で5 重量%のジルコニア原料液を得た。

【0064】上記ジルコニア原料液0.12g、テトラエトキシシラン0.33g、濃塩酸1gとエタノール98.5gを混合してシリカ系膜処理液とした。このシリカ系膜処理液の組成を表1に示す。

【0065】実施例1のシリカ膜処理液に代えて上記シリカ系膜処理液を使用する以外は、実施例1と同様にして撥水処理ガラスを得て測定を行った。シリカ系膜の厚み、各種接触角、表面粗さ等を表2にそれぞれ示す。表2に示すように、撥水剤塗布前のシリカ系膜表面の接触角は29度、撥水処理後の初期接触角は107度、摩擦試験後の接触角は103度を示した。シリカ膜の表面粗さは、Ra=0.4nm、Rz=3.2nmであった。

【0066】[実施例6~9] エタノール(ナカライテスク製)、テトラエトキシシラン(信越シリコーン製) および濃塩酸(35重量%、関東化学製)を表3に示す 割合で調合してシリカ膜処理液を得た。このシリカ膜処理液の組成を表1に示す。

【0067】実施例1のシリカ膜処理液に代えて上記シリカ膜処理液を使用する以外は、実施例1と同様にして 撥水処理ガラスを得て測定を行った。シリカ膜の厚み、 各種接触角、表面粗さ等を表2にそれぞれ示す。

40 【0068】[実施例10~13] 実施例1での撥水処理液の調合に用いたCF,(CF,),(CH,),Si(OCH,),(ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン、東芝シリコーン(株)製)に代えて、実施例10ではCF,(CF,),(CH,),Si(OCH,),(トリデカフルオロオクチルトリメトキシシラン、東芝シリコーン(株)製)を、実施例11ではCF,(CF,),(CH,),SiCl,(ノナフルオロヘキシルトリクロロシラン、チッソ(株)製)を、実施例12ではCF,(CH,),Si(OCH,),(トリフルオロプロピルトリメ50トキシシラン、チッソ製)を、実施例13ではCF

シリカ膜処理液の組成を表1に示す。

, (CH,),Si(OCH,),(トリフルオロプロピルト リメトキシシラン、チッソ製)をそれぞれ用いた以外 は、実施例1と同様にして撥水処理ガラスを得た。各種 接触角等を表2にそれぞれ示す。表2に示すように、撥 水処理後の初期接触角は80~107度、摩擦試験後の 接触角は75~97度であり、耐摩耗性能の優れる撥水 膜が得られた。

【0069】[実施例14~18]実施例1での撥水処 理液の調合に用いたCF, (CF,), (CH,),Si(O CH,),(ヘブタデカフルオロデシルトリメトキシシラ 10 ン、東芝シリコーン製)をアルキルシランに代えた以外 は、実施例1と同様にして撥水および低摩擦抵抗ガラス を得た。この撥水および低摩擦抵抗膜処理液の組成を表 4に示す。

【0070】これらの撥水および低摩擦抵抗ガラスにつ いて、初期および摩擦試験後の接触角を測定した。ま た、摩耗係数測定器(新東科学製)に乾布を取り付け て、膜表面と乾布との間の摩擦係数を測定した。これら の測定結果を表5に示す。表5に示すように、撥水処理 後の初期接触角と摩擦試験後の接触角の差が非常に小さ 20 く、ほとんど撥水性能の劣化が見られなかった。また、 乾布との摩擦係数は、0.22~0.25であり、実施 例1の様にフルオロアルキル基を有するオルガノシラン で処理した場合の0.36、無処理の通常ガラスの0. 42に比較して、摩擦係数の小さいガラスが得られた。 摩擦試験後の摩擦係数は摩擦試験前とほとんど変化はな かった。

【0071】[実施例19]実施例1での撥水処理液の 調合に用いたCF<sub>1</sub>(CF<sub>1</sub>),(CH<sub>2</sub>),Si(OC H,),(ヘプタデカフルオロデシルトリメトキシシラ ン、東芝シリコーン製)を[メトキシ(ポリエチレンオ キシ)プロピル]トリメトキシシラン(チッソ株式会社 製、含有率90%、分子量460~590、エチレンオ キシド単位数6~9) に代えた以外は、実施例1と同様 にして、水滴の転がり始める臨界傾斜角が低く、かつ、 汚れが吸着あるいは付着しにくい機能性膜を得た。

【0072】上記機能性膜の接触角は、38度であっ た。また、水滴の転がりやすさの目安である臨界傾斜角 は、得られた上記機能性膜処理ガラスサンプルを水平に 配置し、その上に直径5mm水滴を置き、ガラス板を徐 40 々に傾斜させて、水滴が転がり始めるときの水平からの 傾斜角度を測定することによって求めたところ、4度で あり、非常に水滴が転がりやすい表面が得られた。さら に、摩擦試験後の接触角は38度であり、摩擦試験後の 臨界傾斜角は4度であって、摩擦試験前とほとんど同じ 性能を維持していた。

【0073】[比較例1]エタノール(ナカライテスク 製) 99gに、テトラエトキシシラン(信越シリコーン 製)0.05g、濃塩酸(35重量%、関東化学製)1

【0074】実施例1のシリカ膜処理液に代えて上記シ リカ膜処理液を使用する以外は、実施例1と同様にして 撥水処理ガラスを得て測定を行った。シリカ膜の厚み、 各種接触角、表面粗さ等を表2にそれぞれ示す。表2に 示すように、撥水剤塗布前のシリカ膜表面の接触角は2 9度、撥水処理後の初期接触角は105度、摩擦試験後 の接触角は60度を示し、摩擦試験後の撥水性能が低下 することがわかる。またシリカ膜の表面粗さは、Ra゠ 0. 5 n m、R z = 6. 2 n m であり、撥水処理後の膜 表面の粗さは、Ra=0.5nm、Rz=6.0nmで あった。シリカ膜および撥水膜のRzがともに5.0n mを超えており、膜の平滑性が劣っていることがわか る。

【0075】[比較例2]エタノール(ナカライテスク 製) 95gに、テトラエトキシシラン (信越シリコーン 製) 4g、濃塩酸(35重量%、関東化学製) 1gを攪 拌しながら添加し、シリカ膜処理液を得た。とのシリカ 膜処理液の組成を表 1 に示す。

【0076】実施例1のシリカ膜処理液に代えて上記シ リカ膜処理液を使用する以外は、実施例1と同様にして 撥水処理ガラスを得て測定を行った。シリカ膜の厚み、 各種接触角、表面粗さ等を表2にそれぞれ示す。表2に 示すように、撥水剤塗布前のシリカ膜表面の接触角は2 5度、撥水処理後の初期接触角は110度、摩擦試験後 の接触角は80度を示し、摩擦試験後の撥水性能が低下 することがわかる。またシリカ膜の表面粗さは、Ra= 0. 9 n m、R z = 8. 8 n m であり、撥水処理後の膜 表面の粗さは、Ra=0.8nm、Rz=9.0nmで 30 あった。シリカ膜および撥水膜のRa、Rzがともにそ れぞれ0.5 n mおよび5.0 n mを超えており、膜の 平滑性が劣っていることがわかる。また、得られた撥水 膜にはムラが見られた。

【0077】[比較例3] エタノール(ナカライテスク 製)99.1gに、テトラエトキシシラン(信越シリコ ーン製) 0.4g、0.1規定塩酸0.5gを攪拌しな がら添加し、シリカ膜処理液を得た。このシリカ膜処理 液の組成を表1に示す。

【0078】実施例1のシリカ膜処理液に代えて上記シ リカ膜処理液を使用する以外は、実施例1と同様にして 撥水処理ガラスを得て測定を行った。シリカ膜の厚み、 各種接触角、表面粗さ等を表2にそれぞれ示す。表2に 示すように、撥水剤塗布前のシリカ膜表面の接触角は2 4度、撥水処理後の初期接触角は110度、摩擦試験後 の接触角は70度を示し、摩擦試験後の撥水性能が低下 することがわかる。またシリカ膜の表面粗さは、Ra= 8 n m、R z = 1 1. 0 n m であり、撥水処理後の 膜表面の粗さは、Ra=0.8nm、Rz=10.5n mであって、シリカ膜および撥水膜の表面粗さは、いず gを攪拌しながら添加し、シリカ膜処理液を得た。この 50 れもRa=0.5nm、Rz=5.0nmを超えてお

り、膜表面の平滑性が劣った。

【0079】[比較例4] エタノール (ナカライテスク製) 89.6gに、テトラエトキシシラン (信越シリコーン製) 0.4g、濃塩酸 (35重量%、関東化学製) 20gを攪拌しながら添加し、シリカ膜処理液を得た。このシリカ膜処理液の組成を表1に示す。

【0080】実施例1のシリカ膜処理液に代えて上記シリカ膜処理液を使用する以外は、実施例1と同様にして撥水処理ガラスを得て測定を行った。シリカ膜膜の厚み、各種接触角、表面粗さ等を表2にそれぞれ示す。表 102に示すように、撥水剤塗布前のシリカ膜表面の接触角は32度、撥水処理後の初期接触角は107度、摩擦試験後の接触角は87度を示し、摩擦試験後の撥水性能が低下することがわかる。また、得られた膜には膜厚ムラが見られた。シリカ膜の表面粗さは、Ra=0.7nm、Rz=9.8nm、撥水処理後の膜表面の粗さは、Ra=0.7nm、Rz=8.9nmであり、いずれもRa=0.5nm、Rz=5.0nmを超えており、膜表面の平滑性が劣った。

【0081】[比較例5]エタノール(ナカライテスク 製) 29.6gに、テトラエトキシシラン (信越シリコ ーン製) 0. 4g、塩酸メタノール溶液(10重量%、 東京化成製)70gを攪拌しながら添加し、シリカ膜処 理液を得た。このシリカ膜処理液の組成を表 1 に示す。 【0082】実施例1のシリカ膜処理液に代えて上記シ リカ膜処理液を使用する以外は、実施例1と同様にして 撥水処理ガラスを得て測定を行った。シリカ膜膜の厚 み、各種接触角、表面粗さ等を表2にそれぞれ示す。表 2に示すように、撥水剤塗布前のシリカ膜表面の接触角 は30度、撥水処理後の初期接触角は108度、摩擦試 験後の接触角は88度を示し、摩擦試験後の撥水性能が 低下することがわかる。また、得られた膜には膜厚ムラ が見られた。シリカ膜の表面粗さは、Ra=0. 7 n m、Rz=8.8nm、撥水処理後の膜表面の粗さは、 Ra=0.7nm, Rz=7.8nm cap 50, cap 50Ra=0.5nm、Rz=5.0nmを超えており、膜 表面の平滑性が劣った。

【0083】 [比較例6] エタノール(ナカライテスク製)86.25gに、テトラエトキシシラン(信越シリコーン製)0.4g、濃塩酸(35重量%、関東化学製)1g、さらに、水12.35gを攪拌しながら添加し、シリカ膜処理液を得た。とのシリカ膜処理液の組成を表1に示す。

【0084】実施例1のシリカ膜処理液に代えて上記シリカ膜処理液を使用する以外は、実施例1と同様にして 撥水処理ガラスを得て測定を行った。シリカ膜膜の厚み、各種接触角、表面粗さ等を表2にそれぞれ示す。表 2に示すように、撥水剤塗布前のシリカ膜表面の接触角は32度、撥水処理後の初期接触角は109度、摩擦試 験後の接触角は86度を示し、摩擦試験後の撥水性能が 50 22

低下することがわかる。また、得られた膜には膜厚ムラが見られた。シリカ膜の表面粗さは、Ra=0. 6n m、Rz=9. 8n m、撥 水処理後の膜表面の粗さは、Ra=0. 7n m、Rz=10. 8n m であり、いずれもRa=0. 5 n m、Rz=5. 0 n m を超えており、膜表面の平滑性が劣った。

【0085】 [比較例7] エタノール(ナカライテスク製)96gに、エチルシリケート(平均重合度約5)の加水分解物(平均分子量408.5、「HAS-10」、コルコート社製、シリカ分10重量%)4gを混合しシリカ膜処理液とした。このシリカ膜処理液の組成を表1に示す。このシリカ膜処理液を、洗浄したガラス基板(300×300mm)上に、湿度30%、室温下でフローコートして塗布、約1分で乾燥した。その後、基板を600℃で1時間焼成しシリカ膜を得た。なお上記焼成前のシリカ膜の硬度を鉛筆硬度で測定したところ、「B」の芯の鉛筆で膜を引っ掻くと膜は傷ついた。そして上記焼成後のシリカ膜は、「H」の芯の鉛筆で膜を引っ掻いても膜は傷つかなかった。

20 【0086】さらに、このシリカ膜被覆ガラスを純水中で10分間超音波洗浄を行い、乾燥した後、実施例1と同様にして、撥水処理し撥水ガラスを得た。表2に示すように、撥水剤塗布前のシリカ膜表面の接触角は2度、撥水処理後の初期接触角は106度、摩擦試験後の接触角は50度を示し、摩擦試験後の撥水性能が著しく低下することがわかる。またシリカ膜の表面粗さは、Ra=0.9nm、Rz=12.1nm、撥水処理後の膜表面の粗さは、Ra=0.8nm、Rz=10.3nmであり、ともにRa=0.5nm、Rz=5.0nmを超え30 ており、膜表面の平滑性が劣った。

【0087】 [比較例8] 実施例15でのシリカ膜塗布工程を行わなかった以外は、実施例15と同様にして撥水および低摩擦抵抗ガラスを得た。各種接触角等を表5にそれぞれ示す。表5に示すように、撥水処理後の初期接触角は95度であり実施例15のガラスについての値と等しかったが、摩擦試験後の接触角は55度であり実施例15のガラスについての値(90度)に比して著しく低く、耐摩耗性能に劣る膜となった。また、摩擦試験後の摩擦係数は0.45であり、摩擦により低摩擦抵抗40機能も失われた。

【0088】 [比較例9] 実施例19でのシリカ膜塗布工程を行わなかった以外は、実施例19と同様にして撥水および低摩擦抵抗ガラスガラスを得た。この機能性膜の接触角は、38度であり、臨界傾斜角は4度であり、ともに実施例19での測定値に等しかった。しかし、摩擦試験後の接触角は22度であり、臨界傾斜角は25度であって、接触角の減少および臨界傾斜角の増加が著しく、耐摩耗性が劣っていた。

[0089]

」【表1】

	テトラブルコキジシラン (SiQ,換算) (重量%)	アルミニウムトリ ア゙トキシド (Al, O, 換算) (重量%)	ジ ルコニウムテトラ ブ トキシド (ZrO,換算) (重量%)	塩酸 (規定)	水 (重量%)
実施例1	0.12	0	0	0.09	0.7
実施例2	0.16	0	0	0.09	0.7
実施例3	0.12	0	0	0.09	0.7
実施例4	0.095	0.006	0	0.09	0.8
実施例5	0.095	0	0.006	0.09	0.8
実施例6	0.014	0	0	0.05	0.5
実施例7	0.058	0	0	0.005	0.5
実施例8	0.58	0	0	0.2	2.0
実施例9	2.3	0	0	0.5	5.0
比較例1	0.003	0	0	0.09	0.7
比較例2	4.3	0	0	0.09	0.6
比較例3	0.12	0	0	0.0004	0.5
比較例4	0.12	0	0	2.0	13.0
比較例5	0.12	0	0	2.0	0.5
比較例6	0.12	0	0	0.09	13.0
比較例7	0.12	0	0	0.00003	0.3
=====	======		=====	=====	=====

【0090】 \* \*【表2】

	沙水系	奠		撥水処	撥水処理ガラス				
	膜厚	接触角	表面粗さ	初期	摩擦試験後	表面粗さ	外観		
			Ra/Rz	接触角	接触角	Ra/Rz			
	(nm)	(度)	(nm)/(nm)	(度)	(度)	(nm)/(nm)			
実施例 1	4 0	3 0	0.4/2.9	108	9 5	0.3/2.8	ОК		
実施例2	40	3 1	0.3/2.8	108	97	0.3/2.7	ΟK		
実施例3	40	3 0	0.4/3.0	108	95	0.4/2.9	ΟK		
実施例4	4 0	3 1	0.4/3.3	106	104	0.4/3.0	ΟK		
実施例5	3 5	29	0.4/3.4	107	103	0.4/3.2	OK		
実施例6	15	28	0.4/3.2	106	93	0.4/3.0	ΟK		
実施例7	30	3 0	0.3/3.3	107	91	0.3/3.2	ΟK		
実施例8	100	28	0.3/2.8	108	98	0.3/2.7	OK		
実施例9	250	27	0.3/2.4	108	90	0.3/2.3	ОК		
実施例10	40	30	0.4/2.9	107	97	0.3/2.8	ΟK		
実施例11	同上	同上	同上	101	90	0.3/2.8	ОК		
実施例12	"	"	<i>"</i>	9 5	8 8	0.3/2.8	ΟK		
実施例13	"	"	"	8 0	7 5	0.3/2.8	ОК		
上較例1	 以下	29	0.5/6.2	105	60	0.5/6.0	ок		
比較例2	300	2 5	0.9/8.8	110	8 0	0.8/9.0	NG		
比較例3	4 5	2 4	0.8/11.0	110	7 0	0.8/10.5	ОК		
比較例4	4 0	32	0.7/9.8	107	8 7	0.7/8.9	NG		
比較例5	4 0	3 0	0.7/8.8	108	8 8	0.7/7.8	NG		

	25	75				26		
			32 06/0	1 (	10 86	0.7/10.9		
	比較例?	40	2 0.0/3	1 10	9 50 16 50	0.7/10.8 0.8/10.3	UK	
(0091)		* * (表3)						
	====		=====					
			テトラエトキシシラ					
		(9) 	(g)		(g) 			
	実施例6	99.5	0.05	0	. 5			
	実施例7	99.3	0.2	0	.05			
	実施例8	96.0	2.0	2	.0			
			8.0					
	====:	====	=====					
092]					【表4】			
	=====					=====:		
		7			<b></b>	エタノール		
				(g) 	(g)	(9)		
	実施例14	 1 n_オクタテ	' シルトリメトキシシラン	1	1	98		
	実施例15	5 n-ドデ	シルトリメトキシシラン	1	1	98		
	実施例16	3 n <i>_オクチル</i>	、シルトリメトキシシラン シルトリメトキシシラン トリエトキシシラン	1	1	98		
	実施例17	7 n_ペンチ。	ルトリエトキシシラン	1	1	98		
	実施例18	3 トリメチルエ	トキシシラン	1	1	98		
0093]	====================================							
		 初期接触 (度)	 角 初期摩擦(		 擦試験後接触 (度)	中 摩擦試験征	 <b>多摩擦</b> 係数	
	実施例14	95	0. 2	3	9 4	0. 2	2 4	
	 実施例15	90	0. 23	 2	9 0	0. 2	23	
						0. 4		
	 実施例16	8 8 8	0. 24	 4	 8 7	0. 2	 2 2	
				_				

0.25

0.25

#### [0094]

低濃度のシリコンアルコキシドと高濃度の揮発性の酸か らなるアルコール溶液を基材に塗布し、常温で乾燥する ととにより、緻密で強固なシリカ膜が被覆された物品が☆

実施例18

実施例17 80

60

☆得られる。またさらに、このシリカ膜を下地膜とし、こ 【発明の効果】以上に説明したように本発明によれば、 40 れに加水分解可能な基と機能性官能基を有するオルガノ シランを塗布することにより、常温における処理で、耐 久性に優れる機能性被覆物品が得られる。

0.23

0.25

フロントページの続き

(72)発明者 砂田 貴

大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本 板硝子株式会社内

(72)発明者 小林 浩明

78

60

大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本 板硝子株式会社内

(72)発明者 山本 博章 大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本 板硝子株式会社内 (72)発明者 小川 永史 大阪市中央区道修町3丁目5番11号 日本 板硝子株式会社内